

電気学会研究会資料目次

光応用・視覚研究会

テーマ「次世代リソグラフィ技術」

〔委員長〕関根征士（新潟大）

〔幹事〕小野 隆（日 大）、石神敏彦（ハリソン東芝ライティング）

日 時 11月28日（金）13：00～17：00

場 所 電気学会第3～5会議室（東京都千代田区五番町 6-2 HOMAT HORIZON ビル 8F, JR 中央線，営団地下鉄有楽町線・南北線，都営地下鉄新宿線，いずれも市ヶ谷駅より徒歩3分，Tel 03-3221-7201）

LAV-03-1 EB 直描を用いた先端デバイスの試作

田村貴央（NEC エレクトロニクス）

多田宗弘（NEC）

藤井 清（NEC エレクトロニクス）

林 喜宏（NEC）・・・ 1

LAV-03-2 先端フォトマスクの開発の現状

毛利 弘（大日本印刷）・・・ 7

LAV-03-3 F2 リソグラフィに向けたフッ化物材料開発の現状

森澤 拓（ショット日本）

ヨルク ハーン，ギュンター グラボッシュ（ショット リソテック）

ルッツ パティエ（ショット日本）

コンラッド クナップ（ショット リソテック）・・・ 13

LAV-03-4 超臨界乾燥を用いた微細レジストパターン形成

菊池幸子（技術研究組合 超先端電子技術開発機構）・・・ 19

LAV-03-5 次世代リソグラフィー用レジスト材料の開発状況

- EPL用ポジ型レジストの開発 -

安波昭一郎，白川浩司，水谷一良（富士写真フイルム）

小久保忠嘉（富士フイルムアーチ）・・・ 25

LAV-03-6 X線リソグラフィーの高解像力化への取り組み

炭谷博昭，綾 淳，糸賀賢二，渡辺 寛（三菱電機） 29

LAV-03-7 NEDO プロジェクト「極端紫外線露光システム技術の開発」の計画

福田恵明（EUVA/キヤノン） 35

協 賛 超微細リソグラフィ調査専門委員会